

NANOBIKクリーンルーム 装置実習会のご案内 ～4元マグネトロンスパッタ装置

4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムは大学・地方自治体・産業界が連携する新しい形の研究教育拠点です。新川崎・創造のもり地区において、ナノ・マイクロスケールの微細加工、評価・解析の各設備を整備し、産業界への開放利用も推進しています。本講習会では、本研究拠点における4元マグネトロンスパッタ装置の原理および活用方法を紹介するとともに、今後のNANOBIKご利用のきっかけとしていただく機会といたしました。

装置

芝浦エレテック社製 4元マグネトロンスパッタ装置

場所

新川崎 創造のもり
NANOBIKクリーンルーム及びKBIC小会議室

開催日

平成28年12月19日(月) 13:00～17:00

定員

先着5名とさせていただきます
参加申込はmatsugaki@newkast.or.jp (松垣) までお願いします

主な用途・特徴

- ・コンパクトで操作が簡単、豊富なオプションを揃えたロードロック式タイプのスパッタリング装置
- ・広範囲に分布が良いスパッタ源を搭載(±5%以内 (SiO₂でΦ170mm以内))

主な機能とオプション

- スパッタ方式: サイドスパッタ
- スパッタ源: 3 inch×3 (4)
- ホルダーサイズ: Φ220mm
- 到達圧力: 5×10^{-4} Pa以下
- 排気時間: 10分で 7×10^{-3} Pa以下
- 加熱温度: 最大300°C
- ターゲット: Ti, Cr, Ni, Auなど



4元マグネトロンスパッタ装置